

SP-3600R



・特徴

本装置は三台の高周波電源 600W(自動整合)を搭載している多元同時スパッタリング用のスパッタ装置です。またサブストレートプラズマクリーニング用の逆スパッタ機構も備えております。排気系は油回転ポンプと磁気軸受型ターボ分子ポンプを採用しており、他のメインポンプに比べてオイルフリーな雰囲気での排気が可能です。カソード部は、3つのターゲットのうち1つは強磁場カソードを採用しておりますので磁性体金属の成膜にも適しております。ガス導入機構・チャンバー加熱機構・公転回転機構・蓋の180℃開閉機構・成膜制御用シャッター機構等成膜に必要な不可欠な機能も装備しております。

・仕様

到達圧力	5.0×10 ⁻⁴ Pa 以下 ※常温・脱ガス完了時・液体窒素使用時
排気速度	9.9×10 ⁻⁴ Pa 以下迄 30 分以内 ※常温・脱ガス完了時・液体窒素使用時
成膜室径	φ460mm×330mmH SUS304 電解研磨
スパッタ用電源	RF 電源 13.56MHz 600W 自動マッチング 3 台 逆スパッタ用 RF 電源 13.56MHz 300W 手動マッチング 1 台
基板形状	3 インチ 3 枚
膜厚分布	φ40mm ズーンにて±15%以内
ターゲット形状	3 インチ(金属・絶縁物)
ターゲット個数	1
基板回転	有り
基板加熱	無し
真空排気系	油回転ポンプ：240L/min[50Hz] ターボ分子ポンプ：330L/sec
操作方法	手動
ガス系統	マスフローコントローラ 1 系統
ユーティリティ	電気：AC200V 三相 6KVA AC100V 单相 0.5KVA 冷却水：10L/min 以上 0.1MPa 以上 0.15MPa 以下 25℃以下循環 計装エア：0.5MPa 以上 寸法： 装置架台本体：1200mmW×850mmD×1635mmH 制御盤：600mmW×600mmD×(1700)mmH